Japanese Patent un-examined Publication No. sho 63-216000

Publication Date: September 8, 1988

Title of the Invention: A fluorescent panel for sensitizing X ray photograph with drying

·by·heating means

Application No. sho 62-50796

Application Date: March 4, 1987 Inventors: Hisanori TSUCHINO

Kuniaki NAKANO

Humio SHIMADA

Applicant: KONICA KK

Claim:

A fluorescent panel for sensitizing X ray Photograph characterized by drying by-heating means which is incorporated into said luminescent panel using fluorescence material emitting fluorescence at the radiation of X-ray.

In Fig. 1,

1: a supporting member

2: a fluorescent layer

3: a protective layer

1H: a heating supporting member

2H: a heating fluorescent layer

3H: a heating protective film

H1, H2, H4: a heating layer

H3: a supporting heating body

In the specification, it is described that "a supporting heating body in which heating member itself has a function as a supporting member also, may be "a carbon fiber sheet".

On the contrary, the allowed claims define that a substrate is made of amorphous carbon which is clearly different from the carbon fiber sheet which is disclosed in this prior art.

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-216000

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和63年(1988) 9月8日

G 21 K 4/00 G 03 B 42/02 42/04 8406-2G -7811-2H

 $\tilde{Z} - 7811 - 2H$ 審査請求 未請求 発明の数 1 (全9頁)

ᡚ発明の名称

加熱乾燥手段を有するX線写真増感用蛍光体パネル

願 昭62-50796 20特

願 昭62(1987)3月4日 23出

②発 明 者 土 野 明 母発 老 加野

久 窓 亜 紀 子 東京都日野市さくら町1番地 小西六写真工業株式会社内 東京都日野市さくら町1番地 小西六写真工業株式会社内

②発 明 者 中 野 ⑫発 明 者 島 田 邦 昭 文 生 東京都日野市さくら町1番地 小西六写真工業株式会社内 東京都日野市さくら町1番地 小西六写真工業株式会社内

の出 頭 人 コニカ株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

PA

1、発明の名称

加热乾燥手段を有するX線写真増感用 世光体 パネル

2. 特許請求の範囲

X線照射時に世光を発する蛍光体を用いるX線 写真増感用蛍光体パネルに加熱乾燥手段を組込ん だことを特徴とするX級写真増感用蛍光体パネル。 3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は医学用X線写真の直接撮影用増感スク リーン成は間接撮影用蛍光スクリーンに関する。 【発明の背景】

直接撮影用地感スクリーン (intensifying scre en、一般に増感紙と呼ばれる)及び間接扱影用低 光スクリーン(fluorescent screen、一般に蛍光 板と呼ばれる)は、X級によって蛍光を発する蛍 光体を、X線撮影に支障のない支持体上に強設し、 更に形成された蛍光休屑を保護層で被覆したもの である。前記増感紙は支持体の表面にハロゲン化

、銀感光層が逸設された写真感光材料(Xレイフィ ルム)に密着させられて保持され、X線が照射さ れることによって発光し、写真感光材料のX級に 対する感度を間接的に向上させている。また蛍光 板に於ては又線像を可視頭像に変換し、これを問 接撮影用カノラあるいは撮影哲等で撮影可能にし ている.

前記増感紙、蛍光板等の蛍光スクリーンは一般 にパネル形態をなしているので以後の説明には両 者を一括してX線写真均感用蛍光体パネル、更に 省略して蛍光体パネル環は単にパネルと称する。

前記均感紙に使用する蛍光体は、従来一般的に 直接撮影用Xレイフィルムの燃色性がレギュラー である場合には4000~5000Aに蛍光スペクトルを 有するタングステン酸 カルシウムを主 来 統 とした **蛍光体ユーロビウム試活硫酸パリウム蛍光体等が** 用いられ更に直接撮影用Xレイフィルムの感色性 がオルソマチックの場合にはテルビニウムを以活 削とした酸化硫化カドリニウム系の5400A付近に ヒークを有する蛍光体等が用いられている。また

関接撮影用Xレイフィルムの感光性はオルソマティックであるので前記蛍光板は5400~5500Åに蛍光スペクトルを有する観を試活剤とする硫化カドミウム亜鉛系のものが使用される。

ところで前記蛍光体は、まづX 線エネルギーの 吸収効率のよいこと、発光効果のよいこと、写真 感光材料の感光スペクトルを効率よくカバーする 蛍光スペクトルを発すること、残光がなく 画像の 鮮鋭性、撮影操作に支障を与えぬことが要求される。

ここに於て、LaOBr:Tb等の希土類蛍光体、BaFBr」
:Eu、BaFCe:Eu等のアルカリ土類蛍光体はX線の吸収効率、発光効率が高く発光スペクトル領域も好通であり、X線写真増惠用蛍光体として好しい。またCsi:Na、Csi:Te、RbBr:Te等のアルカリハライド蛍光体は前記性能を備えると共に蒸着等の気相堆積法によって容易に蛍光体層を形成できるので蛍光体層中の蛍光体光頻密度が100%に近く、結着剤溶液に蛍光体粒子を懸濁、分散させた蛍光体粒料を塗布した蛍光体層に比べ感度、粒状性及

対処するため特性を観性にして吸湿性の少い低光体を選び且つ必要に応じ蛍光体層面を保護層で被 複する方法かとられてきた。

この保護層は、たとえば特別昭59-42500号に記述されているように、保護層用強布欲を蛍光体層上に直接塗布して形成されるか、あるいはあらかとめ別途形成した保護層を蛍光体層上に接着する方法により形成されている。

しかし、前記保護圏は履厚を厚くして水分の透透率を下げようとすると関係の鮮飢性が劣化して しまうため原層化する必要があり、水分の透過を 完全に防止することは不可能であった。このため 所記BaFBr:Euのようなアルカリ土類金属系の蛍光 体、Csl:Haのようなアルカリ金属系の蛍光体、ないはLaOBr:TL蛍光体等の吸湿性が著しいば光体は 吸湿による特性の劣化が起こりこれら蛍光体は 吸吸収効率、発光効率などの語符性が優れている は吸収効率、発光効率などの語符性が優れている にもかかわらず、X線写真増感用蛍光体として利 用することは困難であった。

前配位光体パネルの耐用性を向上するために特

び國像の辞録性が若しく向上して好ましい。 また更に蛍光体パネルには模返し使用が可能で あること(耐用性)が強く要求される。

即ち、前記供光体バネルは、得られるX線函像 の頭質を劣化させることなく反期間あるいは多数 回の構造しの使用に耐える性能を有することが望 まれる。そのためには前記位光体パネル中の位光 体層が外部からの物理的あるいは化学的刺激から 十分に保護される必要がある。 しかしながら蛍光 体は一般に吸湿性であり、とくに前記者土類、ア ルカり土類或はアルカリハライド系の蛍光体は吸 湿性が強い。前記蛍光休層が水分を吸収すると、 アルカリ土類系蛍光体(例えばBaFBr:Eu)等は分解 しX級に対する感度が低下する。またアルカリハ ライド系位光体(例えばCsl:Na)苛は吸湿、脱湿に よりX線に対する感度が変動し、撮影条件が不安 定となり、また得られるX級頭像の函質の劣化を もたらすため、前記蛍光体層に水分が含有されな いよう保護することが望まれる。

従来の蛍光体パネルにおいては、上記の間別に

に耐湿性防湿手段の点でのよりいっそうの改良が 望まれているが、前記保護層の透湿性を低下させ るための方法以外は防湿性に関してほとんど検討 されていないのが現状である。

【発明の目的】

本発明は、遊光体パネルにおける前述のような現状に鑑みてなるれたものであり、本発明の目的は蛍光体層の乾燥度を保ち、長期間にわたり良好な状態で使用が可能である蛍光体パネルを提供することにある。

【発明の構成】

前記した本発明の目的は、X根照射時に蛍光を発する蛍光体を用いるX線写真増燃用低光体パネルに加熱乾燥手段を組込んだことを特徴とするX線写真増燃用蛍光体パネルによって達成される。

尚本発明の想線として前記加無乾燥手段は蛍光体パネルの構成層、支持体中に含有組込まれてもよいし、発熱体からなる層を別途設けてもよい。

次に本発明を具体的に説明する。

X線照射時蛍光を発する蛍光体を用いる蛍光体

バネルは、一般に支持体上に低光体層(以後低光層と略称する)と該蛍光層の機能を補充するための各種構成層(例えば保護層、フィルタ層或は接着層等)からなっている。

第1 図に本発明の蛍光体パネルの各種燃料を別示する。

第1図(a)において、1は支持体、2Hは乾燥乾燥用免熱体(以後発熱体と略称する)か含有組込まれた免熱体光層、3は保護層である。尚談保護層が低光層の開調面まで被覆する例を示した。同図(b)は世光層2に対する支持体1の裏面に発熱体からなる発熱層H1が支持体1に接して設けられており、同図(c)において発熱体からなる発熱層H2は支持体に関し世光層2と同郷、支持体に接して設けられ、保護層3は世光層2のみの全変面を被覆している。同図(d)において1Hは支持体中に発熱体か含有組込まれた発熱支持体である。同図(c)へにおいては、H3は発熱体自身が支持体を兼ねる支持発熱体であり、保護層3が世光層2及び支持発

パネルの乾燥もしくは防湿のための加熱湿度範囲は40~150℃、好しくは40~80℃であって、該湿度範囲においては、支持体、保護層に非耐熱性業材(例えばボリエチレンテレフタレート等)使用の自由が許される。また加熱温度が高すぎると、X級照射時に蛍光層の感度低下を生じたり、残光量が増大したり、写真感光材料が熱カブリを生じたりして好しくない。

加熱の時期はX級関係を与えるX級照射時および/または非照射時の任産時期でよい。乾燥に要する時間は含湿により30%相対感度に低下したパネルに於て680でで1.0~2.0時間でほぼ100%に回復できる。尚気相堆積による粘溶剂フリーの蛍光層の方が乾燥効率(速度回復選度)がよい。

また照射時よりも非照射時の加熱温度を高め能 燥効果を上げる等の方策を躊じてもよいし、照射 時は加熱を中止するようにしてもよい。

また使用の度毎に逐次乾燥処理を行ってもよい し、夜間等の非使用時或は蛍光体が水分により分 解しその機能回復不能に陥入らない限度の長期貯 同図(1)は発熱層||4が蛍光暦2の上面に接して設けられ、同図(g)では蛍光暦2が発熱層||2および||14に差決まれた無様である。同図(h)は発熱体が含有組込まれた発熱保護層3||を有する例である。

本預明のパネルは上例に限らないが、弱熱体からなるか或は発熱体が含有組込まれた層が蛍光層と写真感光材料との側に位置する場合には、該パネル該発熱体層は蛍光に対し透明な物質が用いられる。

前記発熱体が含有組込まれた層あるいは発熱支持体にはカーボンブラック」金属数粉束等の専定性微粉束を用いられることが好しい。

また独然体からなる発熱層には、透明な酸化インソウム等の電気抵抗体の金属酸化物或は金属等の蒸煮、スパッタリングによる寝跡、またはカーボンブラック、金属微粉末等を分放懸損する塗料の盗布膜が用いられる。

また、前記発熱体自身が支持体を兼ねる支持発熱体には、カーボンファイバシート等が用いられる。

旬後に一括除湿処理を行ってもよい。

前記した態様例のように発熱体をパネルに組込む場合、発熱体は電流回路を形成しパネル全面に充分加熱効果を及しうる形態及び配置に関る支障を避けた形態であれば如何様のパターンを採ってもよい。その例を第2 図に示す。同図(a)は発熱体に均一種周回路を形成させた例であり、同図(b)は構型、同図(c)は周曲単線型回路とした例である。第2 図においてPは電極、Hは発熱体である。

次にパネルの乾燥温度制御は熱電対等の温度検 出器に温度制御器、ヒータ用電源を組合せること によって容易に行うことができる。第3回にその 1例のブロック図を示した。

また別価に加熱・乾燥装置を併用いてもよい。 次に本発明のパネルの除湿効率の一例を貼る図 に示す。該パネルの構造は第1図(c)の仕様であ り、蛍光体としてはCsl:Ha蛍光体を用いている。

また第5回に前記パネルの蛍光層の含水率(水 18/坪尽層 9)と蛍光発光強度の関係を示す。

図に明かなように蛍光層の加熱により、該層の

際温及び防湿がなされ、パネルの耐用性が保証される。

本発明のパネルにおいて用いられる支持体としては各種高分子材料、ガラス、ウール、木綿、紙、金属等が用いられ、またそれらの組合せとしてもよい。 信報記録材料としての改扱い上可提性のあるシート 次いはウェブに加工できるものでもよく、この点から例えばセルロースアセテートフィルム、ボリエステルフィルム、ボリエチレンテレフタレートフィルム、 ポリアミドフィルム、 ポリカーポネイトフィルム 等のプラスチックフィルムが好ましい。

また、これら支持体の履厚は用いる支持体の材質等によって異なるが、一般的には80μx~1000 μzであり、取扱い上の点から、さらに好ましく は150μx~500μzである。

これら支持体の表面は滑面であってもよいし、 蛍光層との接着性を向上させる目的でマット面と してもよいしまた下引層を設けてもよい。

あってもよい。

上記世光体のうち特に水分に弱い蛍光体は、Le OBr:Tb: 系蛍光体、アルカリ土類金属系蛍光体、アルカリ土類金属系蛍光体、アルカリ金属系蛍光体であり、これら蛍光体に本発明を適用するとその効果は特に大きい。

本発明のパネルは前記の世光体の少なくとも一 種類を含む一つ若しくは二つ以上の世光層から成 る世光層群を有してもよい。また、それぞれの蛍 光層に含まれる蛍光体は同一であってもよいが異 なっていてもよい。

前記世光層は、特開昭61-73100号に述べられているように世光体を蒸着法、スパッタリング法等の方法を用いることにより結着剤を含有しない層 状構成として支持体上に形成してもよいし、世光 体を適当な結着剤中に分散して堕布粮を調製し、 それを支持体上に整布することにより形成しても よい。この時世光体柱子の平均粒径は0.1~100 μα、好しくは0.5~30μαである。本発明のパネ ルにおいて、結着剤を用いる場合には、例えばゼラ チンの如き蛋白質、デキストランの如きポリサッ - 本籍明の蛍光体パネルに用いられる蛍光体としては、

Y:0:S:Tb、Gd:0:S:Tb、La:0:S:Tb、(Y,Gd):0:S:
Tb、(Y,Gd):0:S:Tb,Tm、Y:0:S:Eu、Gd:0:S:Eu、
(Y,Gd):0:S:Eu、Y:0:Eu、Gd:0:Eu、Gd:0:S:Eu、
(Y,Gd):0:S:Eu、Y:0:Eu、Gd:0:Eu、Gd:0:Eu、(Y,Gd):0:Eu、
Eu、YYO:Eu、YPO:Tb、GdPO:Tb、LaPO:Tb、
YPO:Eu、LaOBr:Tb、LaOBr:Tb,Tm、LaOCL:Tb、
LaOCL:Tb,Tm、GdOBr:Tb、GdOCL:Tb、CaMO.、CaMO
:Pb、MgMO.、BaSO:Pb、BaSO:Eu**、(Ba,Sr)SO:
:Eu**、Ba;(PO.):Eu**、(Da,Sr);(PO.):Eu**、
BafCl:Eu**、BafDr:Eu**、BafCl:Eu**,Tb、BafBr
:Eu**,Tb、Baf:,BaCl:,KCl:Eu2*、Baf:,BaCl:,
BaSO:,KCl:Eu**、(Ba,Ng)f:,BaCl:,KCl:Eu**、
Cs!:Na、Cs!:Tl、RbBr:Tl、RbBr,CsBr:Tl、Nai、
ZnS:Ag、(Zn,Cd)S:Ag、ZnS:Cu、ZnS:Cu,Al、
(Zn,Cd)S:Cu、(Zn,Cd)S:Cu,Al、(Zn,Cd)S:Au,Al、
RfP:0:Cu**のX 報 致 然 体 が 為 げ ち れ る。

しかし、本発明のパネルに用いられる蛍光体は、 前述の俊光体に限られるものではなく、X線照射 時に発光を示す蛍光体であればいかなる蛍光体で

カライドまたはアラビアゴム、ポリビニルブチラート、ポリ酢酸ビニル、ニトロセルロース、エチルセルロース、塩化ビニリデン-塩化ビニルコポリマ、ポリノチルノタクリレート、塩化ビニル-酢酸ビニルコポリマ、ポリウレタン、セルロースアセテートブチラート、ポリビニルアルコール等のような通常関係はに用いられる結業剤が使用される。

しかし、本発明のパネルに関しては、とくに前記特別昭 61-73100号において提案されているように、 蛍光周が結着剤を含有しない構造を有することが好ましい。 結着剤を含有しない蛍光層の形成法としては、以下のような方法があげられる。

第1の方法として蒸煮法がある。該方法においては、まず支持体を蒸煮装置内に設置した複裝置内を装置内に設置した複裝置内を構気して10-*Torr程度の真空度とする。次いで、前配置光体の少なくとも一つを抵抗加熱法、エレクトロンビーム法等の方法で加熱蒸発させて前記支持体表面に蛍光体を所望の厚さに堆積させる。

この結果、結婚剤を含有しない蛍光層が形成をれるが、前記蒸煮工程では複数回に分けて蛍光層

を形成することも可能である。また、前出蒸着工程 では複数の抵抗加熱器あるいはエレクトロンピー ムを用いて共蒸着を行うことも可能である。

また、前記蒸剤法においては、世光体原料を複数の抵抗加熱器あるいはエレクトロンビームを用いて共蒸剤し、支持体上で目的とする低光体を合成すると同時に低光層を形成することも可能である。

さらに前記蒸着法においては、蒸着時、必要に応 じて被蒸着物を冷却あるいは加熱してもよい。ま た、蒸着終了後低光層を加熱処理してもよい。

第2の方法としてスパッタリング法がある。該方法においては、蒸剤法と同様に支持体をスパッタ装置内に装置した後装置内を一旦排気して10-Torr程度の真空度とし、次いでスパッタリング用のガスとしてAr,Ne等の不活性ガスをスパッタ装置内に導入して10-Torr程度のガス圧とする。

次に、前記蛍光体をターゲットとして、スパッタリングすることにより、 前記支持体表面に蛍光体を所望の厚さに堆積させ、 前記燕者法と同様に蛍

ースなどのセルロース誘導体、あるいはポリメチルノタクリレート、ポリピニルブチラール、ポリア ニルホルマール、ポリカーボネート、ポリ酢酸ピニル・ポリアクリロニトリロニトリル、ポリノチルピニルケトン、セルフースシアセテート、セルローストリアセテート、セルローストリアセテート、ポリアクリルア、ポリクリルで、ポリグリン、ポリアクリルアミン、ポリビニルアミン、ポリビニルアミン、ポリビニルアミン、ポリビニルアミン、ポリビニルでは、ポリアミド(ナイロン)、ポリアミド(ナイロン)、ポリアミド(ナイロン、ポリアンが、ポリアミド(ナイロン、ポリアン、ポリアミド(ナイロン、ポリアンが出化エチレン、ポリアミド(ナイロン、ポリアにカル、ポリアミド(ナイロン、ポリプロピレン、四条化エチレン・六条化プロピンス

また、特別昭61-176900号に述べられているように放射級硬化型樹脂または熱硬化型樹脂の少なくともいずれか一方を含有する強布液を保護層を設置すべき面に鉱布し、特別昭61-176900号に示したような装置を用いて劣外級あるいは電子線など

光暦を形成することができる。

第3の方法としてCVD法がある。該方法は目的とする供光体あるいは蛍光体原料を含有する有機金属化合物を熱、商局波電力等のエネルギで分解することにより、支持体上に結婚剂を含有しない蛍光層を得る。

第4の方法として吹着け法がある。 該方法は蛍光体粉末を粘着層上に吹き着けることにより支持体上に結着剤を含有しない蛍光層を得る。

本発明のパネルの蛍光層の層厚は、目的とするパネルのX線に対する感度、蛍光体の種類等によって異なるが、結着剤を含有しない場合で60μz~1000μzの範囲、さらに好ましくは100μz~800μzの範囲から選ばれるのが好ましく、結着剤を含有する場合で100μz~1000μzの範囲、さらに好ましくは100μz~500μzの範囲から選ばれるのが好ましい。

本発明に於ては前配のような保護層を設けることが好ましい。保護層用材料としては、たとえば 酢酸セルロース、ニトロセルロース、エチルセルロ

の放射線の照射および/または加熱を施して前記 塗布液を硬化させてもよい。

前記放射級硬化型樹脂としては、不飽和二重結合を有する化合物またはこれを含む組成物であればよく、このような化合物は、好ましぐは不飽和二重結合を2個以上有するブレポリマおよび/またはオリゴマであり、さらに、これらに不飽和二重結合を有する単量体(ビニルモノマ)を反応性希釈剤として含有させることができる。

前記のように形成される保護層の一層の層厚は
0.5μ m ~ 1000μ m程度、さらに好ましくは 1 μ m ~
50μ m程度の範囲にあることが好ましい。またSiOz,
SiC, SiN, AdzOa等の無機動型層を真空蒸発法、スパッタリング法等により形成してもよい。前記無機動型層の層厚は 0.1μ m ~ 10μ m程度が好ましい。

本発明のパネルは、支持体上に蛍光層を設けた後に酸蛍光層上に保護層を形成して製造してもよいし、あらかじめ形成した保護層を前定蛍光層上に付設して製造してもよい。あるいは保護層上に蛍光層を形成した後、支持体を設ける手順をとっ

てもよい.

尚保護暦には蛍光スペクトル領域に有害な吸収 がないことが好ましい。

【实施例】

次に、実施例によって本発明を説明する。 変施例1

支持体として500μ z 厚の化学強化か ラスを蒸着 器中に設置した。次に抵抗加熱用のタングステンポート中にアルカリハライド 蛍光体 (Csi:0.003Na) を入れ、、抵抗加熱用電極にセットし、続いて蒸 着器を排気して2×10-Torrの真空度とした。

次にタングステンポートに電流を放し、抵抗加 然法によってアルカリハライド蛍光体を蒸発させ 化学強化ガラス上に蛍光層の層厚が300μπの厚さ になるまで堆積させた。

次にこのパネルを大気中に取出した後、化学強化ガラスの輝尽層の設けられていない面に、ポリイミドフィルム上にITOを蒸着した導電膜シート(ミクロ技術研究所製、10Ω/□)を接着し、また蛍光層表面には20μ×厚の透明ポリエチレンテレフタ

実施例1で作製したパネルAの蛍光層を加熱しないで30℃で相対温度70%の恒温室に放置し、経時による感度変化を測定した結果を第6図曲線のとして示す。

第6図より、本発明のパネルは役光層を加熱することによって吸湿による感度の低下を防止し、 耐用性が保証される。

更施例4

アルカリハライド飲光体(0.9RbDr・0.1Csi: 0.0001/Ti) 8 瓜鼠部とポリピニルブチラール樹脂1 重量部と溶剤(シクロヘキサノン) 5 重量部を用いて混合・分散し、微光層用盤布限を興製した。次にこの盤布限を水平に置いた500μa厚の化学強化カラス支持体上に均一に強布し、自然乾燥させて300μa厚の郵尽層を形成した。

このようにして得られたパネルの化学強化ガラスの蛍光層の設けられていない面に実施例1と同様の専電性シートを接着し、また蛍光層表面には20μ=厚の透明ポリエチレンテレフタレートシートを接着して本発明のパネルCを得た。

レートシートを接着して、第1図(b)に示した構造 の本発明のパネルAを提た。

このパキルAに電優と外3図の様な温度制御回路を取付け、80℃に供光層を加熱しなから、30℃、和村温度70%の恒温室に放置し、経時による歴度変化を測定した結果を第6図曲線 aに示す。

実施例 1 において、蛍光層の加熱を140℃にした以外は実施例 1 と同様にして経時による感度変化を制定し、第 6 図曲線 bをえた。

突施例3

実施例1において、支持体として予め世光度を設ける個に透明導電数(170,10Q/□)が蒸着されている500μ m厚の化学強化かラスを用いた以外は実施例1と同様にして本発明のバネルBを存た。 尚透明導電膜上には透明導電膜と拡光体との反応を防止するためのSiO数(2000Å)が設けてある。次にこのバネルBの経時による感度変化を実施例1と同様にして選定し、第6図曲線Cとして示す。比較例1

実施例1のパネルAと本実施例のパネルCとを30 でで相対湿度80%の恒温室に十分長期間放置した 後、30でで相対湿度60%の恒温室に取り出し、第 3 図の様な湿度制舞回路を取付け、蛍光層を80で に加熱して前記パネルA,Cの感度回復の様子を調べた。結果を第8 図曲線d(パネルA)、曲線e(パネルC)として示す。

比較明2

実施例 1 のパネル Aを実施例 4 と同様に 30℃で 相対湿度 80%の 恒温室に十分長期間放置した後、 30℃で相対湿度 60%の恒温室に取り出し、蛍光層 を加熱しないで前配パネル Aの過度回復の様子を 調べた。結果を第7 図曲線 gとして示す。

第7図より、本発明のパネルは吸湿により一旦 感度が低下しても、蛍光層の加熱により感度が回 復することがわかる。尚、本発明のパネルのうち パネルAは蛍光層に結着剤を含んでいないので、 感度の回復が早い。

【発明の効果】

以上述べたように加熱機構を内蔵させた本発明

のパネルは、

- (1) 加熱することにより、蛍光体への水分の吸 力が防止され、放射線に対する速度の低下が阻止 される。
- (2) 加熱することにより蛍光体に吸着された水分が放出され、水分吸着による蛍光体の劣化性化が回復する。
- (3) 加熱することにより、長寿命残光を引きおこすトラップレベルが減少してS/Nが向上する。

等の好ましい挙動を有し、パネルの耐用性か上 る。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明のパネルの 整様例の断面図である。 第2図は発熱体の回路パターンを示す図、第3図は温度制御のブロック図である。

第4図はバネル蛍光層の除湿効率を示す図であり、第5図は蛍光層の含水率と感度の関係を示す図である。

第6図は防湿に対する温度効果を示し、第7図 は加熱による感度回復挙動を示すグラフである。 1 … 支持体、

2 … 蛍 光 屑 、

3 … 保護曆、

1 月 … 强热支持体、

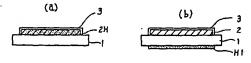
2 日 … 発熱低光層、 3 日 … 発熱保護層、

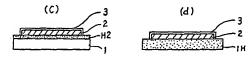
H 1, H 2 及 U H 4 ··· 発 热 層 、

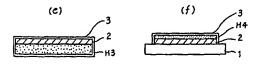
H 3 … 支持 発熱体。

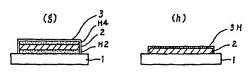
出职人 小西六写真工案株式会社

第 1 図









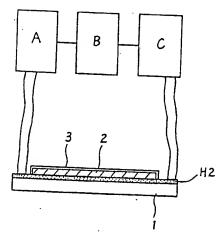
第 2 図

(a)

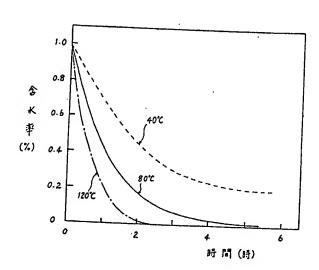
(b)

(c)

第 4 図



A: 温度検出器 B: 温度制御器 C: ヒータ用電源 H2: 発熱層



第 5 図

第 7 図

